

「第 34 回 真空展 VACUUM2012」併設「真空トピックス」
日本真空学会 10 月研究例会
スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会 (SP 部会)
第 130 回定例研究会・ISSP2013 プレセッション
～スパッタ・プラズマを利用した先端技術とその基礎～

スパッタリング技術・プラズマ技術は、各種産業の基盤技術として、また最先端の材料開発・デバイス開発において不可欠なプロセスとして、広く利用されています。

1991 年にスタートした International Symposium on Sputtering and Plasma Processes (ISSP) は、20 年以上にわたって、これらプロセスのメカニズムや、得られる膜とプロセスパラメータとの相関などについて、基礎的な知識を交換・集積するための場を提供してまいりました。また研究者のみならず、実際の現場で作業をしている技術者の皆様に、これらの知見を広く提供することも、本会議の大きな目的のひとつです。

このたびは、来年 7 月に開催される ISSP2013 のプレセッションを、日本真空学会 講演・研究会企画委員会と SP 部会の合同研究会として開催いたします。注目を集めている各種薄膜応用デバイス開発の第一線でご活躍の研究者・技術者の方々をお招きし、製膜プロセスに関連した知見がどのように生かされているかを含め、開発動向についてお話しくさるようお願いしました。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

日 時：2012 年 10 月 17 日 (水) 13:00～16:45 (受付 12:30～)
場 所：東京ビッグサイト 会議棟 605 会議室
定 員：120 名

—講演プログラム—

- 開会の挨拶 ISSP2013 実行委員長 中野 武雄 (成蹊大学) 13:00～13:05
1. 「固体薄膜二次電池の高機能化 (仮題)」
(岩手県立産業技術短期大学校) 馬場 守 13:05～13:45
2. 「薄膜のクロミック現象を用いた調光ミラーガラスの開発」
(産業技術総合研究所) 吉村 和記 13:45～14:25
3. 「半導体/金属錯体ハイブリッド光触媒による人工光合成
・ 太陽光、水、二酸化炭素から有機物の直接合成 ・」
(株式会社豊田中央研究所) 荒井 健男 14:25～15:05
- (休憩 15:05～15:20)
4. 「次世代不揮発性メモリ MRAM の量産技術の現状と課題」
(キヤノンアネルバ株式会社) 恒川 孝二 15:20～16:00
5. 「新型不揮発性メモリ量産技術の現状」
(株式会社アルバック) 西岡 浩 16:00～16:40
- 閉会の挨拶 日本真空学会 講演・研究会企画委員長 杉山 直治 ((株) 東芝) 16:40～16:45

参加費（予稿集代・消費税を含む）

スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会会員	無料
日本真空学会・日本真空工業会会員	3,000 円
一般	5,000 円
学生	1,000 円

※お申込は事前に行ってください。ただし、余席があれば当日も受け付けます。
参加費は当日、申し受けます。

内容についての問合せ先：一般社団法人 日本真空学会 事務局

TEL: 03-3431-4395 FAX: 03-3433-5371

E-mail: ofc-vsja@vacuum-jp.org

*申し込みは、下記ウェブページの併催事業よりお願いします。

VACUUM2012 真空展 <http://www.nikkan.co.jp/eve/vacuum/>

*申込についての問合せ先： 日刊工業新聞社 事務局 イベント事業部内

TEL: 03-5644-7221 FAX: 03-5641-8321